

Kundenspezifischer Ptfе-Waferträger Reinigungskorb

Korrosionsbeständig Nicht Auslaugend Hochpolymer-Experimentträger

Artikelnummer: PL-CP264



Einführung

Hochleistungs kundenspezifische PTFE-Waferträger und Reinigungskörbe, entwickelt für Halbleiter- und Polymerforschung. Mit außergewöhnlicher Korrosionsbeständigkeit und null Auslaugungseigenschaften gewährleisten diese maßgefertigten Lösungen kontaminationsfreie Verarbeitung in anspruchsvollen chemischen Umgebungen für heutige hochpräzise Labor- und Industrieanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
Nassätzung für Halbleiter	Halten von Siliziumwafern während säurebasierter Ätzprozesse zum Entfernen von Oxiden oder Definieren von Strukturen.	Chemische Inertheit verhindert Badkontamination.
Spuremetallanalyse	Reinigung von Laborgläsern und Proben in hochreinen Säurebädern für Umwelt- oder Geologieforschung.	Keine Metallauslaugung gewährleistet analytische Genauigkeit.
Polymersynthese	Unterstützung von Katalysatorträgern oder Substraten bei lösungsmittelbasierten Reaktionen bei hohen Temperaturen.	Hohe Thermische Beständigkeit und Antihaf-Oberfläche.
Solarzellenherstellung	Transport großformatiger Siliziumsubstrate durch mehrstufige Reinigungs- und Texturbäder.	Robuste Konstruktion für hohen Durchsatz.
Pharmazeutische Reinigung	Sterilisierung und Reinigung empfindlicher Glas- oder Metallkomponenten in aggressiven Reinigungslösungen.	Erfüllt hohe Reinheits- und Kontaminationsfreiheitsstandards.
Elektrochemische Abscheidung	Halten von Substraten während der Metallbeschichtung oder Abscheidung in korrosiven Elektrolytlösungen.	Elektrische Isolation und chemische Stabilität.
Verarbeitung von Optoelektronik	Reinigung und Handhabung von Glas- oder Saphirsubstraten für die LED- und Laserdiodenherstellung.	Kratzfreie Handhabung und rückstandsfreies Spülen.
Hochtemperaturtrocknung	Direktes Überführen von Wafern aus Nassbädern in beheizte Trockenkammern oder Öfen.	Behält strukturelle Integrität bis 260°C.

Merkmal	Spezifikationsdetails (PL-CP264-Serie)
Produktidentifikation	PL-CP264 Kundenspezifischer Waferträger
Hauptmaterial	Hochreines jungfräuliches PTFE (optional PFA verfügbar)
Anpassungsstatus	100% maßgefertigt / auftragsbezogen gefertigt
Temperaturbereich	-200°C bis +260°C (-328°F bis +500°F)
Chemische Verträglichkeit	Universell (Alle Säuren, Basen, Lösungsmittel, außer geschmolzene Alkalimetalle)
Schlitzkonfiguration	Anpassbar (Breite, Abstand, Winkel und Tiefe)

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
Merkmal	Spezifikationsdetails (PL-CP264-Serie)	
Waferverträglichkeit	Kundenspezifische Größen für 1", 2", 4", 6", 8", 12" oder nicht standardmäßige Formen	
Herstellungsverfahren	Hochpräzise CNC-Bearbeitung	
Oberflächenbeschaffenheit	Glatt, reibungsarm, porenfrei	
Griffoptionen	Integriert, abnehmbar oder Roboterschnittstelle	
Chargenkapazität	Entworfen nach Benutzerspezifikation (Einzel- oder Mehrfachwafer)	